



## 一种氧化锆涂层制备工艺

文献类型：专利

作者 孙超, 王启民, 宫骏, 王铁刚, 刘山川, 华伟刚, 鲍泽斌, 肖金泉 and 闻立时

发表日期 2008-11-19

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明涉及涂层制备技术,具体地说是一种氧化锆涂层的制备工艺,采用电弧离子镀技术在合金基体或电弧离子镀MCrAlY涂层上利用纯Zr或ZrY合金靶材在O<sub>2</sub>气氛内反应沉积ZrO<sub>2</sub>或Zr(Y)O<sub>2</sub>涂层。本发明所涉及的这种氧化锆涂层制备工艺具有好的工艺重复性和容易实现工业化生产等优点,制得的ZrO<sub>2</sub>和Zr(Y)O<sub>2</sub>涂层组织均匀致密,为柱状晶结构,具有良好的结合强度,Zr(Y)O<sub>2</sub>涂层抗热冲击性能优良。

公开日期 2008-11-19

语种 中文

专利申请号 CN101307424

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/67676]

专题 金属研究所\_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 孙超, 王启民, 宫骏, 王铁刚, 刘山川, 华伟刚, 鲍泽斌, 肖金泉 and 闻立时. 一种氧化锆涂层制备工艺. 2008-11-19.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：金属研究所

浏览

106

下载

0

收藏

0

## 其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

